

**Rámcové téma práce č. 33: Fotorezistové reliéfní záznamové materiály**

**Typ práce:** BP (VÚ)

**Vedoucí práce:** Ing. M. Květoň, Ph.D.<sup>65</sup>

**Kozultant(i):** Ing. J. Svoboda, Ph.D.<sup>66</sup>

**Student:**

**Abstrakt:** Optickou expozicí fotorezistů dochází k lokální změně rozpustnosti materiálu, což se projeví jeho odstraněním ve vývojkách a vytvoření reliéfní struktury. Tímto postupem lze vytvářet zajímavé difraktivní struktury pro optiku, které lze snadno replikovat. V rámci tématu se student seznámí s problematikou fotorezistů (typy, vlastnosti, chemické složení, mechanismy záznamu), naučí se připravovat vzorky tenkých vrstev fotorezistových materiálů a pomocí optické expozice vyrábět reliéfní struktury. Vedle experimentální realizace struktur bude cílem práce modelování procesů probíhajících při optickém záznamu a chemickém vyvolávání, které vedou k odstranění materiálu a vzniku reliéfu.

---

<sup>65</sup><mailto:milan.kveton@jfji.cvut.cz>

<sup>66</sup><mailto:jakub.svoboda@jfji.cvut.cz>